Влияние диффузии валентных дырок на возбуждение Al₂O₃ в треках быстрых тяжелых ионов

<u>Р.А. Рымжанов</u>¹, J. O'Connell², В.А. Скуратов¹, Н.А. Медведев³, А.Е. Волков^{1,4}

¹Лаборатория ядерных реакций ОИЯИ, г.Дубна, Россия ²CHRTEM, Nelson Mandela Metropolitan University, Port Elizabeth, South Africa ³CFEL at DESY, Notkestr. 85, 22607 Hamburg, Germany ⁴НИЦ «Курчатовский институт», г. Москва, Россия



Быстрые тяжелые ионы

- E > 1 МэВ/нуклон, М > 4m_р
- Потери энергии на электронное торможение
- Моделирование воздействия осколков деления и космических лучей на свойства материалов





Почему Al_2O_3 ?

- Радиационно-стойкий материал
- Кандидат на роль инертной матрицы для ядерного топлива в реакторах деления
- Широкощелевой диэлектрик использование в электронике
- Необходимо экспериментальное и теоретическое исследование влияния облучения осколками деления на свойства материала



Модель термической вспышки использует макроскопическое уравнение диффузии, применение которого затруднено в условиях наномасштаба и малых времен процессов в треках БТИ. Константа электрон-фононной связи используется как подгоночный параметр

Необходимо построение новых мультимасштабных моделей для описания процессов в треках БТИ

Формализм комплексной диэлектрической функции

Учитывает коллективную реакцию системы на возбуждение

$$\frac{d^2\sigma}{d(h\omega)dq} = \frac{2(Z_e e)^2}{n_e \pi h^2 v^2} \frac{1}{q} \operatorname{Im}\left(\frac{-1}{\varepsilon(\omega, q)}\frac{1}{\dot{j}}\right)$$

Введен учет диффузии валентных дырок!!!



R.H. Ritchie, A. Howie, Philos. Mag. 36 (1977) 463–481 R.A. Rymzhanov, N.A. Medvedev, A.E. Volkov, Nucl. Instrum. Methods. B. 326 (2014) 238–242.

Молекулярная динамика



Результаты МД





Ион Хе 167 МэВ ИЦ-100 ЛЯР ОИЯИ

ПЭМ микроскопия

Деформационное поле







Normalized density (Arb. nuits) 1.04 1.00 0.96 0.92 0.95 0.92 0.95 0.92 0.95 0.92 0.95 0.92 0.9

Плотность материала вокруг поврежденной области



Наблюдаемое количество треков меньше флюенса ионов. Уровень насыщения для иона Xe – 1.2x10¹² см⁻²

Возможная причина согласно МД – термическая рекристаллизация (отжиг). Эффективный радиус для Хе – 6.5 нм, что соответсвует уровню насыщения ~2.5x10¹² CM⁻² *V.A. Skuratov, J. O'Connell et al. NIMB* 326 (2014) 223–227

- Построена модель возбуждения материала в треках БТИ
- Продемонстрирована важность диффузии валентных дырок для процессов возбуждения и релаксации материала
- Модель показала хорошее согласие с экспериментальными данными
- Выявлен эффект рекристаллизации трековых областей. Максимальный эффективный радиус рекристаллизации составляет ~ 6нм.





Спасибо за внимание!

Моделирование возбуждения электронной подсистемы (код **TREKIS**)

00.001

1000

100

Radius (A)

Lattice energy density (eV/A³)

10⁻⁴

10⁻⁵

10⁻⁶

10⁻⁷

1

10



Радиальный профиль нагрева решетки был использован в молекулярнодинамическом моделировании релаксации избыточной энергии атомов